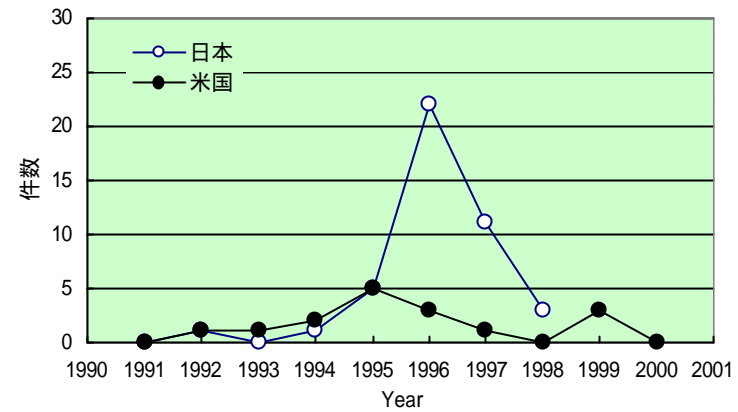
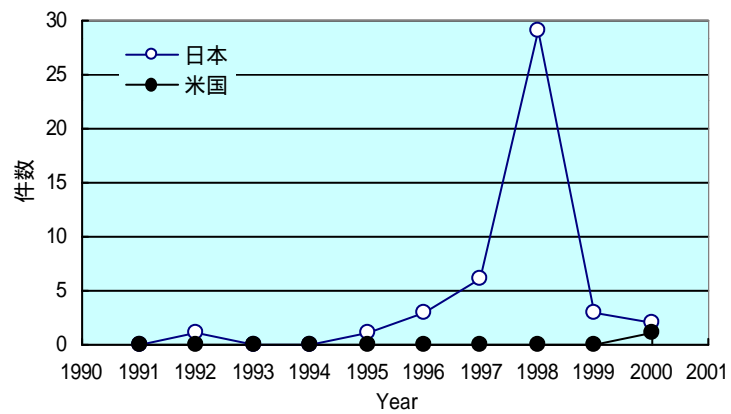


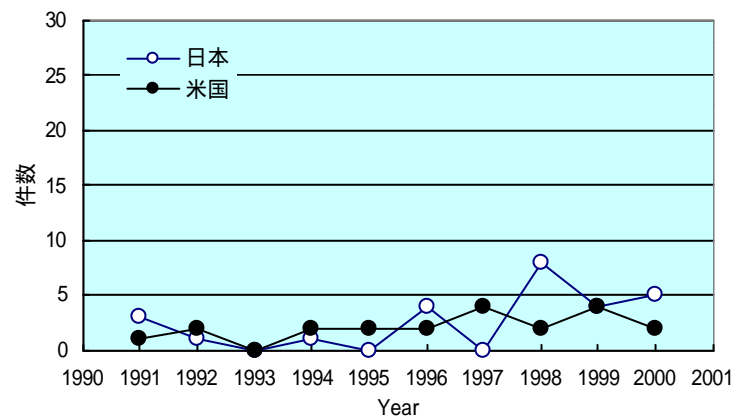
(a) 論文数推移



(b) 自国への出願動向

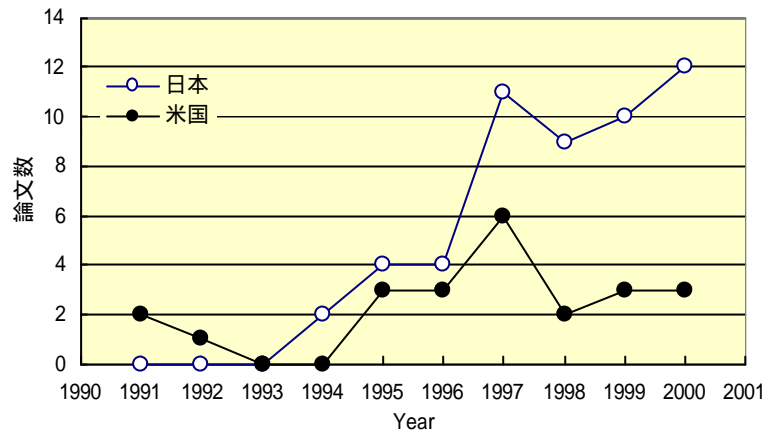


(c) 日本における特許登録数推移

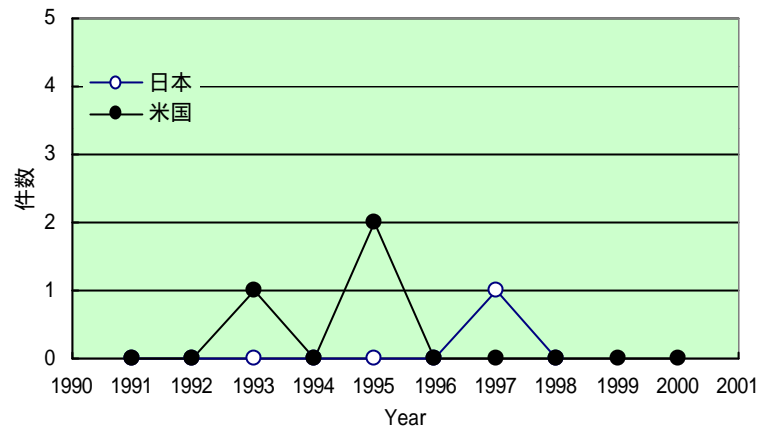


(d) 米国における特許登録数推移

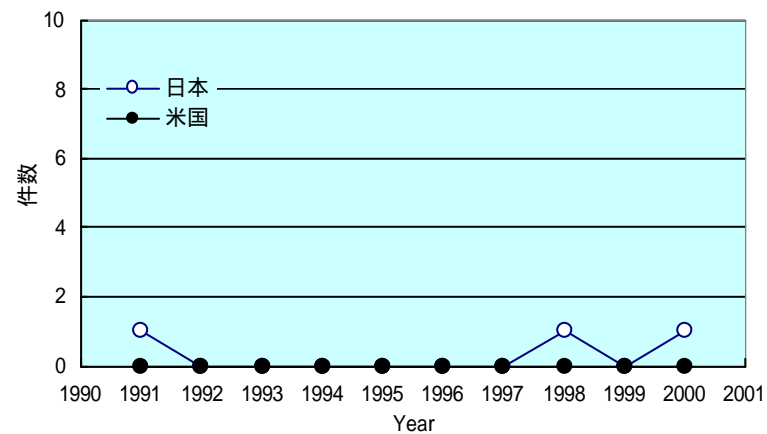
図 5.1-7 ホスト - ゲスト材料に関する科学・技術競争力評価



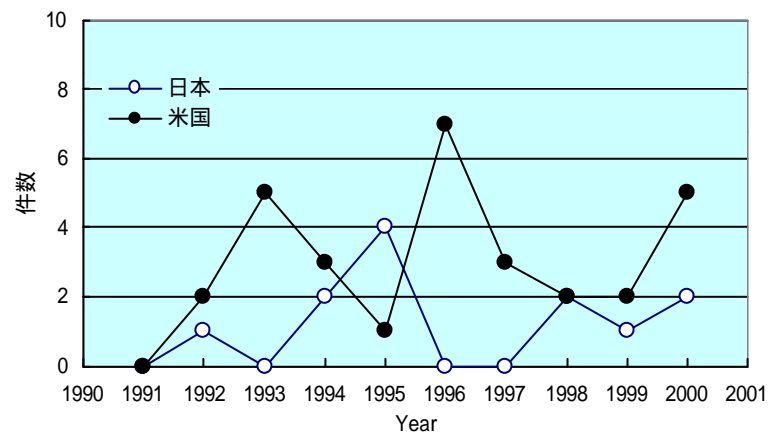
(a) 論文数推移



(b) 自国への出願動向

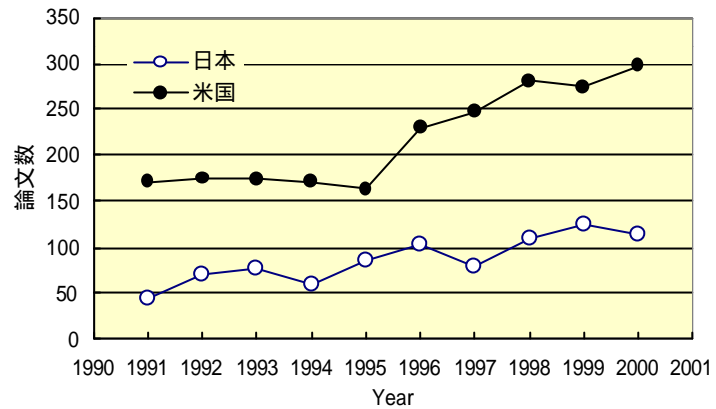


(c) 日本における特許登録数

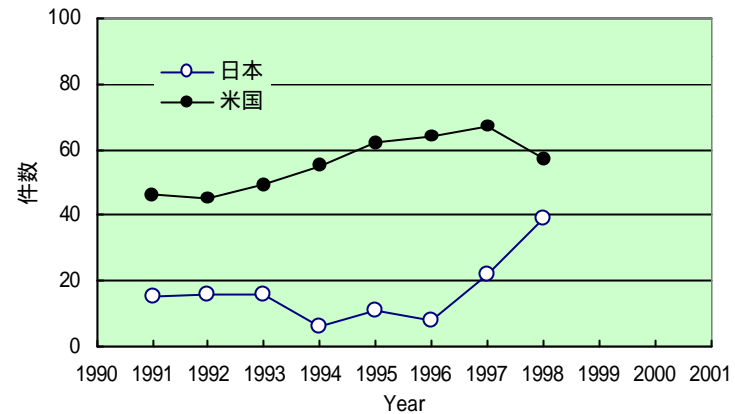


(d) 米国における特許登録数

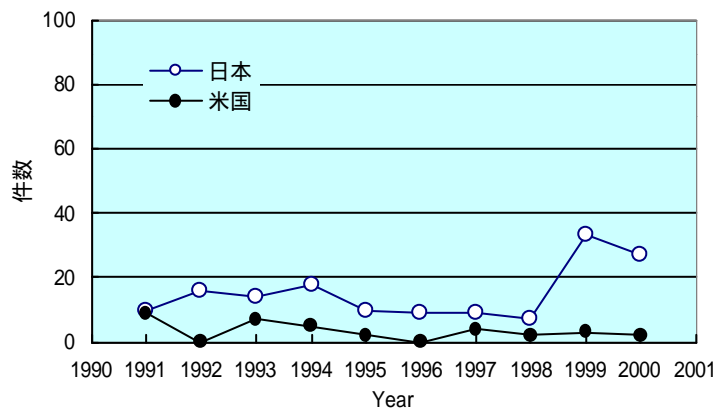
図 5.1-8 プロトン材料に関する科学・技術競争力評価



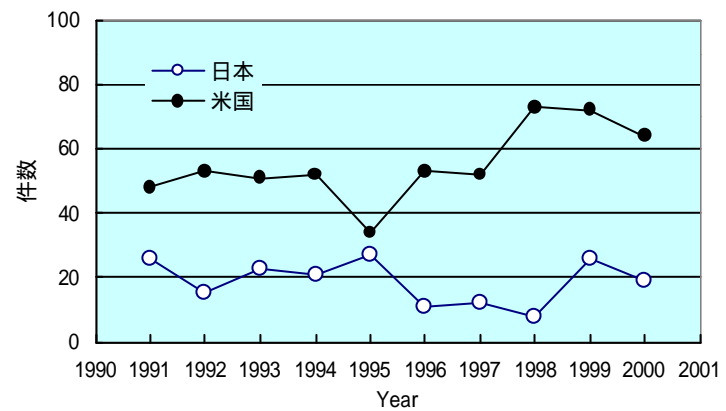
(a) 論文数推移



(b) 自国への出願動向

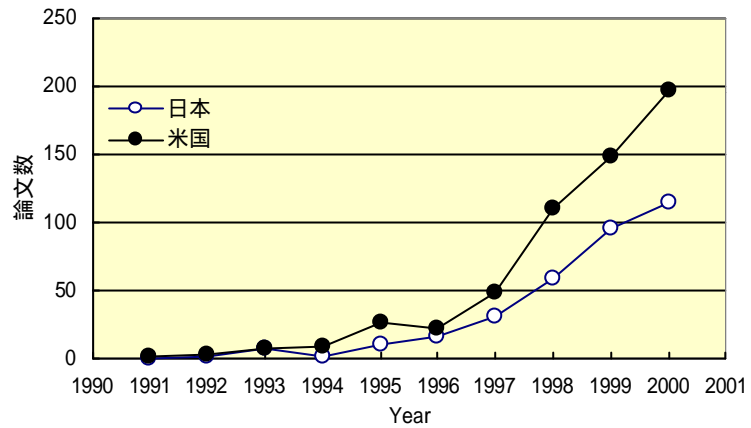


(c) 日本における特許登録数推移

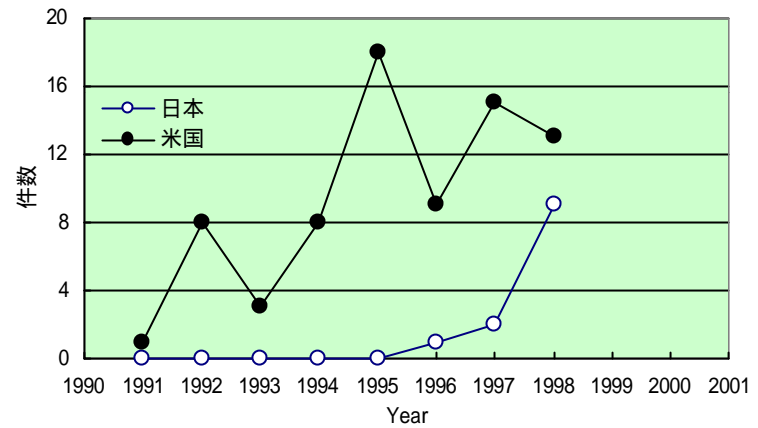


(d) 米国における特許登録数推移

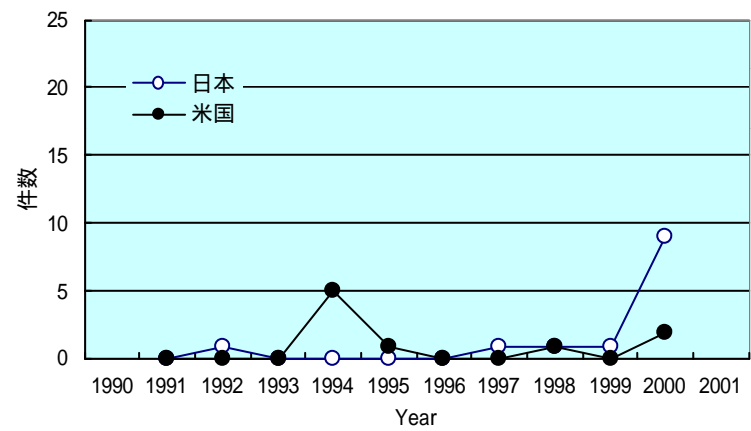
図 5.1.-9 ナノエマルジョンに関する科学・技術競争力評価



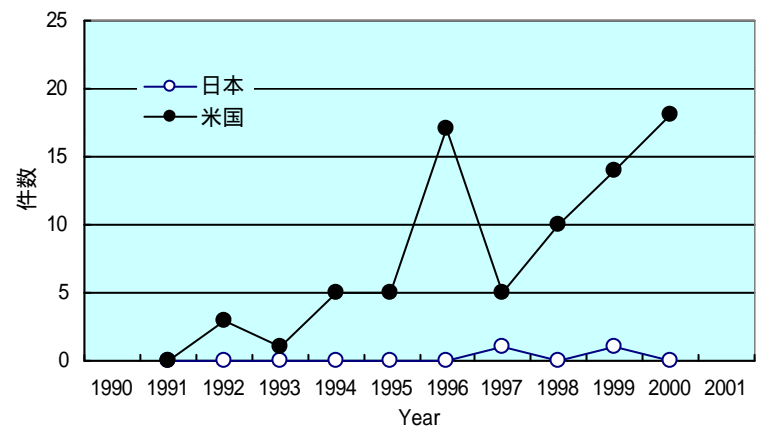
(a) 論文数推移



(b) 自国への出願動向

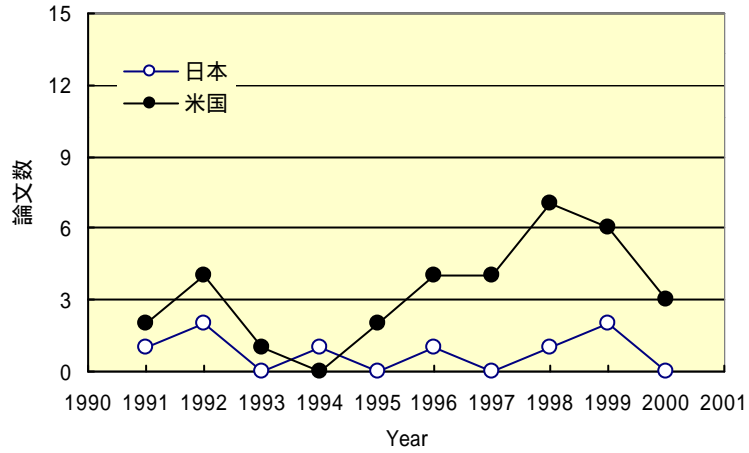


(c) 日本における特許登録数推移

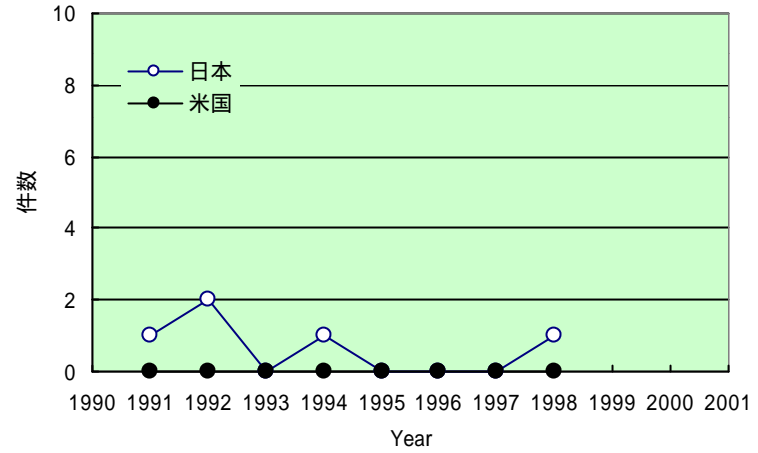


(d) 米国における特許登録数推移

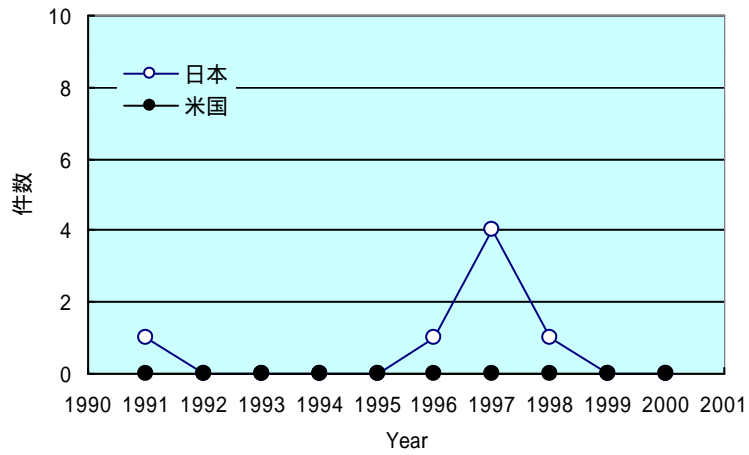
図 5.1-10 ナノスフェアに関する科学・技術競争力評価



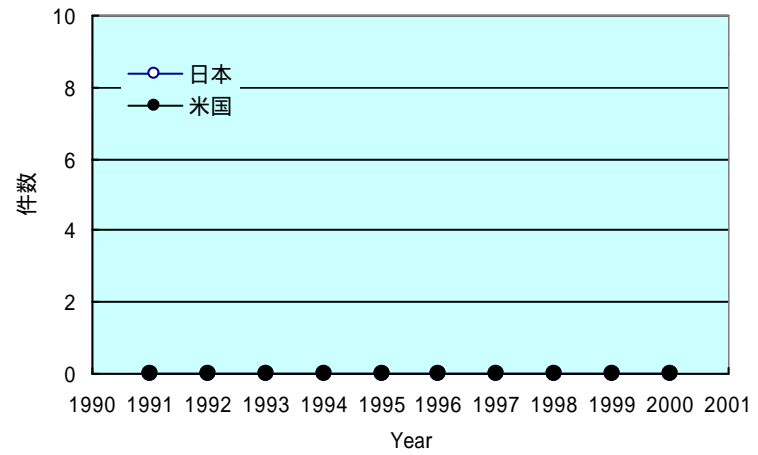
(a) 論文数推移



(b) 自国への出願動向

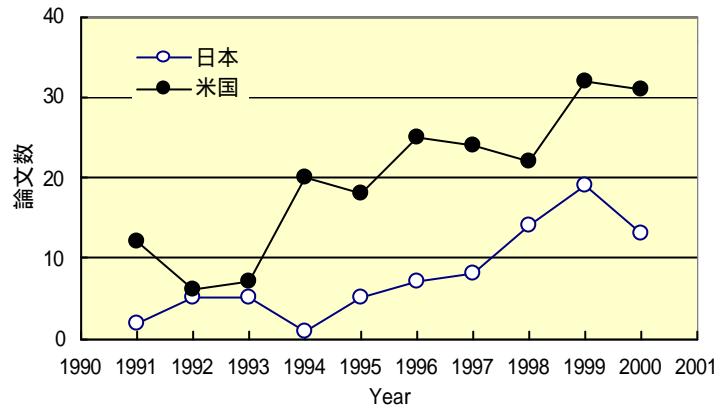


(c) 日本における特許登録数推移

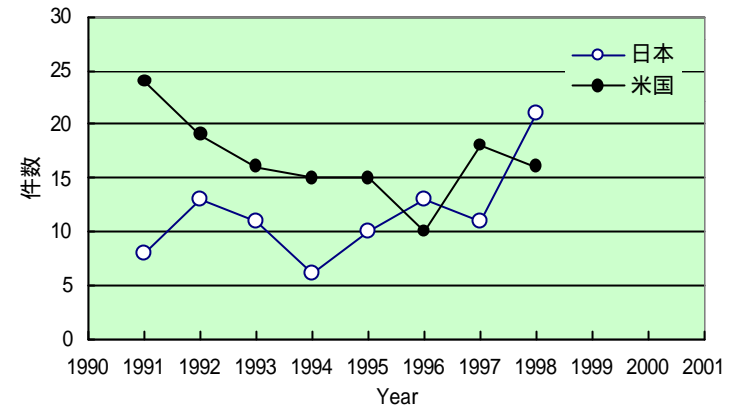


(d) 米国における特許登録数推移

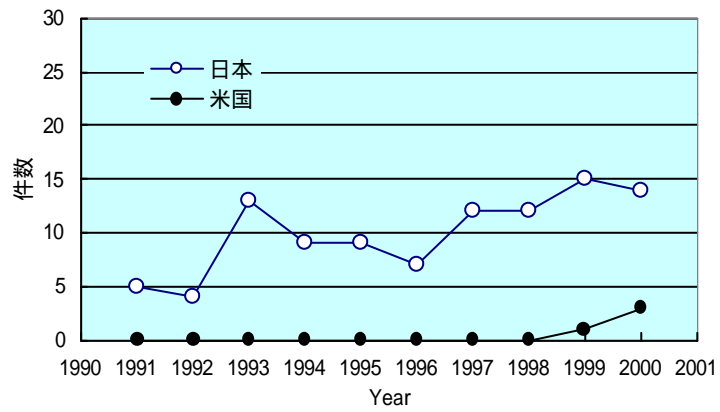
図 5.1-11 テーラーメイド化学に関する科学・技術競争力評価



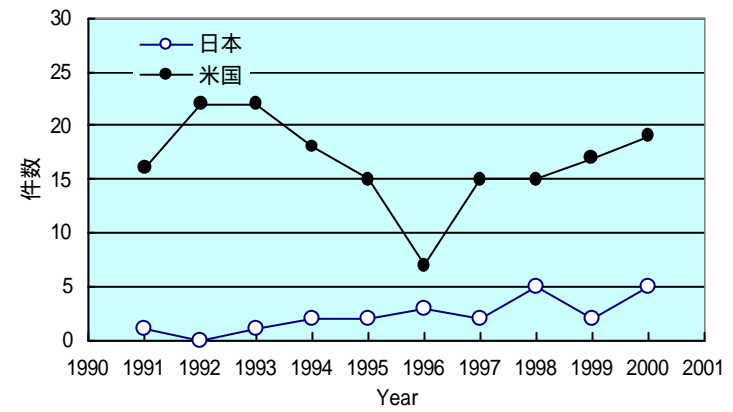
(a) 論文数推移



(b) 自国への出願動向

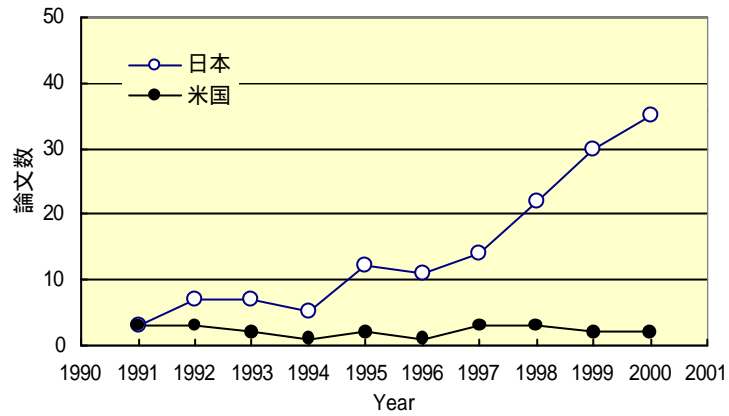


(c) 日本における特許登録数推移

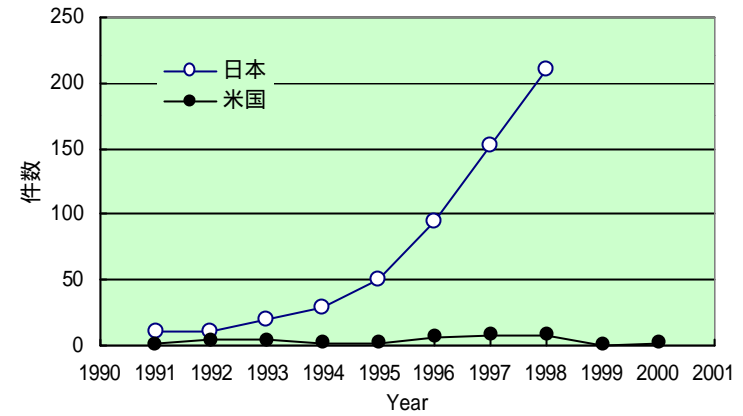


(d) 米国における特許登録数推移

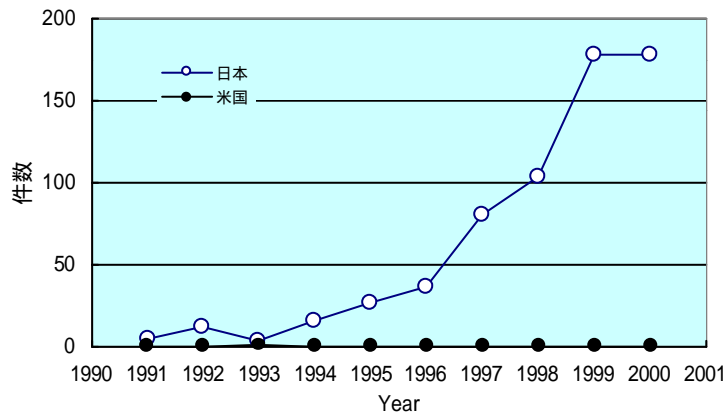
図 5.1-12 環境触媒に関する科学・技術競争力評価



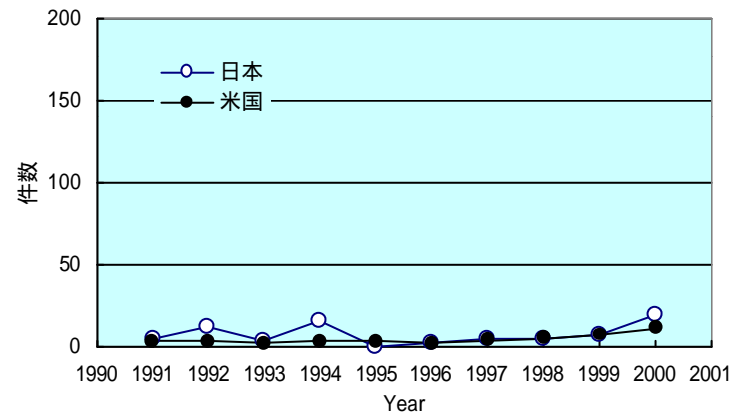
(a) 論文数推移



(b) 自国への出願動向



(c) 日本における特許登録数推移



(d) 米国における特許登録数推移

図 5.1-13 光触媒に関する科学・技術競争力評価